



J20

DUAL TARGET ION SPUTTER COATER

双靶离子溅射仪

The J20 is a dual-target ion sputter coater based on magnetron sputtering technology. Equipped with a high-performance rotary vane pump, it can quickly establish a vacuum environment below 4 Pa. With its coordinated design of tilted dual-target and rotary sample stage, it deposits uniform and stable conductive coatings on sample surfaces. The system is ideally suited for high-resolution FE-SEM sample preparation, particularly for 3D powder samples and delicate specimens. Available sputtering materials include Au, Pt, Pd, Ir as well as Pt-Au and Pt-Pd layered alloys, etc.

J20是一款基于磁控溅射原理的双靶离子溅射仪，采用高性能旋片泵可快速建立低于4 Pa的真空环境，结合倾斜双靶与旋转样品台的协同设计，可在样品表面形成均匀、稳定的导电镀层，广泛适用于高分辨场发射电镜样品、特别是3D粉末类和易损伤类样品的镀层制备。可溅射金属：Au、Pt、Pd、Ir和任意组份的Pt-Au、Pt-Pd 叠层合金等。

触摸屏控制，即插即用。



双靶磁控溅射
特色Pt-Au叠层配方

倾斜靶+旋转台设计
对3D类样品友好

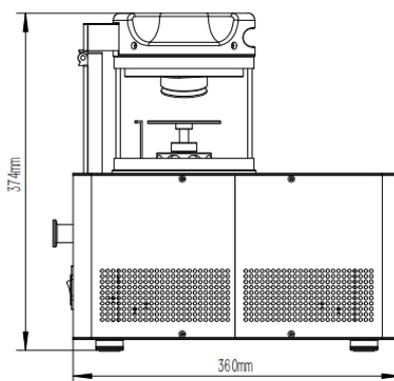
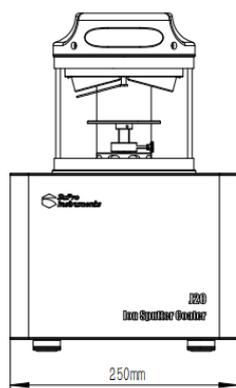
样品场景通用性强

SuPro Instruments Limited

速普仪器

Nanshan,
Shenzhen, China
www.suproinst.com
Tel: 86-755-26642901
Fax: 86-755-26419205
Email: sales@suproinst.com

技术规格	参数
适用场景	高分辨场发射扫描电镜 (FE-SEM) 样品表面导电镀层制备
真空泵	高性能旋片泵
抽速	$\geq 4 \text{ m}^3/\text{h}$
极限真空	$< 1 \text{ Pa}$
设置气压	4-10 Pa
抽真空时间	$< 2 \text{ min}$
溅射计时	0-300 s
真空计	皮拉尼真空计
腔体 (标配)	石英玻璃腔体 (外尺寸 $\text{Ø}150 \text{ mm} \times \text{H} 120 \text{ mm}$)
旋转样品台	直径: $\text{Ø}80 \text{ mm}$; 转速: 60 RPM; 工作距离: 55-70 mm (连续可调)
溅射靶材	标配2片靶材 ($\text{Ø}30 \text{ mm}$, 厚0.2-1 mm), 支持单靶溅射与双靶顺序溅射
溅射电源	恒功率直流磁控溅射电源, 输出: 1-20 W; 0-100 mA; 0-800 V
操作方式	触摸屏控制, 控制系统提供互锁保护功能
主机重量	$\sim 15 \text{ kg}$
主机尺寸	250 mm 宽 \times 360 mm 深 \times 374 mm 高
输入电源	100-240 V AC, 50/60 Hz, 三脚接地插头
功耗	$< 500 \text{ W}$
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205

邮件: sales@suproinst.com

www.suproinst.com

速普仪器 (太仓) 有限公司

地址: 苏州市太仓健雄路大学科技园11号楼1003

邮件: zkchang@suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司 (北京办)

地址: 北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室